

DOSES DE SILÍCIO EM MUDAS DE SERINGUEIRA SOB DIFERENTES AMBIENTES

PEREIRA, Talita Cristina Campos¹ (tally_cris131@hotmail.com); **AGUIAR, Franciele Kelle Oliveira Moura**¹ (francieleaguiar2008@hotmail.com); **PAULINO, Leonardo Albino**¹ (leonardo-paulino1@hotmail.com); **SALLES, Josiane Souza**² (josi_souzasalles@hotmail.com); **COSTA, Edilson**³ (mestrine.uems@gmail.com); **SCALOPPI JÚNIOR, Erivaldo José**⁴ (scaloppi@iac.sp.gov.br);

¹ Discente do curso de Agronomia da UEMS – Cassilândia;

² Discente do Programa de Pós Graduação em Sustentabilidade na Agricultura da UEMS - Cassilândia;

³ Docente do curso de Agronomia da UEMS – Cassilândia.

⁴ Pesquisador IAC – Votuporanga.

A qualidade de mudas é um dos fatores de maior importância na implantação de uma cultura. Em mudas de seringueira para porta-enxerto são necessários cuidados fitossanitários rigorosos para que não inviabilizem todo processo de enxertia realizado posteriormente. O silício vem sendo utilizado em várias culturas por beneficiar tanto fatores abióticos como bióticos. Ainda são poucos os trabalhos envolvendo a aplicação desse nutriente na cultura da seringueira. O presente estudo teve o objetivo de avaliar doses de silicato de potássio em diferentes níveis de sombreamento no crescimento inicial de mudas de porta-enxerto de seringueira, clone GT1. O experimento foi conduzido na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Cassilândia-MS. Foram utilizados dois tipos de ambientes protegidos: (A1) estufa agrícola com tela termo-refletora aluminizada LuxiNet 42/50 móvel; (A2) sem sombreamento, pleno sol. As sementes foram coletadas no Instituto Agrônomo (IAC) em fevereiro de 2018. A semeadura ocorreu em 24 de fevereiro de 2018 e o transplante para os sacos de polietileno de 1,8 L ocorreu aos 29 dias após a semeadura (DAS). As doses utilizadas foram 0 e 3,0 L/ha, totalizando duas aplicações (70 e 100 DAS), que foram realizadas com o auxílio de pulverizador manual. Para avaliação do crescimento inicial foram analisadas as alturas das mudas, o diâmetro do colo, o diâmetro a 5 cm do colo, números de folhas e nível de danos de ataque de insetos e doenças, sendo realizadas aos 83 e 128 DAS. Os dados foram submetidos à análise de variância e quando significativas às médias foram comparadas pelo teste t de student, ambos a 5 % de probabilidade. A aplicação de silício na estufa agrícola promoveu maiores alturas das plantas, bem como maiores diâmetros a 5 cm do colo. Enquanto que no ambiente sem sombreamento não houve diferença estatística entre as variáveis. Não houve ataque de insetos nos dois ambientes utilizados, não podendo ser mensurados os níveis de danos nos tratamentos.

Palavras-chave: ambiente protegido, *Hevea brasiliensis*, clone GT1.

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro autor, a FUNDECT/PRONEM pelo apoio financeiro e o IAC/Votuporanga por fornecer as sementes.



Realização:

UFGD
Universidade Federal
da Grande Dourados

UEMS
Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul

Parceiros:

CAPES

CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico